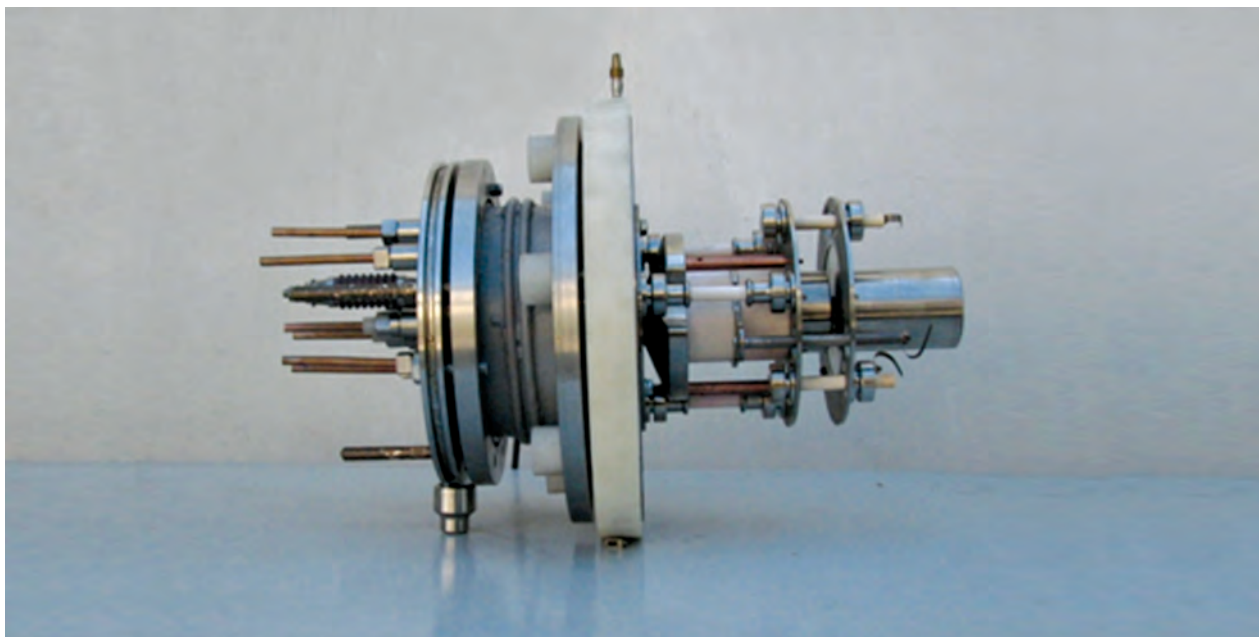


ВИСОКОЕФЕКТИВНЕ ДЖЕРЕЛО БАГАТОЗАРЯДНИХ ІОНІВ МЕТАЛІВ



Призначення

Для проведення іонної імплантації матеріалів одно/двозарядними іонами металів (Be, Fe, Cr, Ni, Zr, Mo, W та інші) та імітаційних досліджень впливу іонного опромінення на конструкційні матеріали ядерної та термоядерної техніки

Характеристики

Тип іонів пучка	Be, Fe, Cr, Ni, Zr, Mo, W
Струм іонів, мкА	10–200
Енергія іонів, кеВ	30
Зарядність іонів	+1, +2
Споживана потужність, Вт	1000

Охорона інтелектуальної власності

IPR1, IPR2

Переваги

Джерело металевих іонів дає змогу генерувати пучки одно- та двозарядних іонів металів на основі іонно-плазмового розпилення. Застосований в іонному джерелі спосіб створення робочого середовища дозволяє формувати атомарну концентрацію та плазму високої густини практично будь-яких металів (Be, Fe, Cr, Ni, Zr, Mo, W та ін.) без необхідності нагрівати джерело до високих температур

Рівень готовності розробки. Пропозиції до комерціалізації

IRL3, TRL4
Можливе виробництво одиничних зразків джерела власними силами або спільно з потенційними партнерами

Контактна інформація

Ворошило Олексій Іванович, Інститут прикладної фізики НАН України,
+38 054 222 46 08, +38 054 222 27 94, e-mail: voroshilo@ipfcentr.sumy.ua